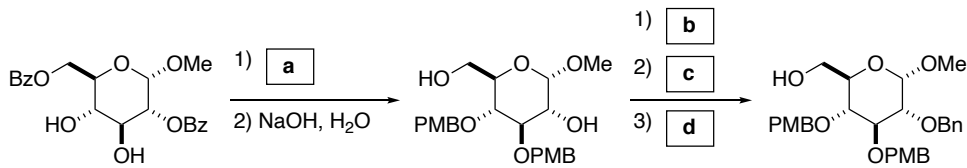


研究室

学籍番号

氏名

問 1.



a: PMBOC(=NH)CCl₃, H⁺ または PMBCl, Ag₂O (アルコールの PMB 保護。PMBCl, NaH だと Bz の除去も併発し、収率が低くなるので、酸性～中性条件での保護が望ましい)

b: TBSCl, imidazole または TBSCl, Et₃N, DMAP (1 級アルコール選択的な保護。続く Bz の除去と生じたアルコールの Bn 化条件に耐えられ、かつ嵩高い保護基を選択する。シリル系保護基が望ましく、嵩高い TBS 基か TBDPS 基が最適。TBSCl, Et₃N, DMAP はポリオールの 1 級アルコール選択的保護の条件として優れている)

c: BnBr, NaH (Bn 基での保護。イミデート法での保護も可)

d: TBAF (Bn 基と PMB 基存在下のシリル基の脱保護)

問 2.

